

第20回関西表面技術フォーラムプログラム ①

2018年11月21日

9:40	実行委員長挨拶 節原 裕一 (大阪大学)
------	----------------------

座長

	時間		ページ
1	9:45	貴金属-AgBr接合ナノ粒子の合成 (近畿大)◎高橋怜希、副島哲朗	
2	10:00	マンガン酸化物ナノ粒子の形状制御法の開発 (近畿大)◎大田祐輔、副島哲朗	
3	10:15	貴金属ナノ粒子とレーザー誘起ブレイクダウン分光を組み合わせた液体の高感度微量分析 (兵庫県立大)◎島津佑輔、善積沙紀子、松本 歩、八重真治	
4	10:30	金属ナノ粒子@メソポーラスシリカ@多孔性金属錯体3層構造体の創製 (甲南大)◎大橋卓史、鶴岡孝章、高嶋洋平、赤松謙祐	

10:45 ~ 11:00 休憩

座長

	時間		ページ
5	11:00	電析Ni合金における熱脆化の抑制:第一原理計算による材料設計と実験的検証 (産総研*、大阪府立大**)◎松井 功*、大手里奈**、久井志紘**、上杉徳照**、尾村直紀*、瀧川順庸**、東 健司**	
6	11:15	無電解Ni-Pめっきによる水素脆性と水素透過性 (広島工大*、阪大**、上村工業***)◎土居悠帆*、堀川敬太郎**、小田幸典***、日野 実*	
7 技	11:30	マグネシウム合金の接着性に及ぼす表面処理の影響 (広島工大*、堀金属表面処理工業**、岡山理大***)◎一藤勇斗*、今井田至世*、西條充司**、金谷輝人***、日野 実*	
8 技	11:45	電解砥粒研磨後に得られるアルミニウム合金の表面状態 (岡山工技セ*、山本金属製作所**)◎築山訓明*、村上浩二**、辻 善夫*、渡辺哲史*	

12:00 ~ 13:15 休憩

座長

	時間		ページ
9	13:15	火花放電パルスアノード酸化によるアルカリ金属複合酸化皮膜の作製 (近畿大院)◎土屋佳祐、岩崎光伸	
10	13:30	火花放電パルスアノード酸化によるパターンニング膜の作製とその表面特性 (近畿大院)◎山崎隆嗣、岩崎光伸	
11	13:45	火花放電アノード酸化によるCr ₂ O ₃ -Al ₂ O ₃ 固溶体皮膜の作製 (近畿大)◎野平 匠、岩崎光伸	
12	14:00	無機ナノ蛍光体埋入大孔径アノード酸化皮膜の作製 (近畿大院)◎山田紘平、岩崎光伸	
13	14:15	鉄系合金めっき膜のアノード酸化によるナノ多孔質酸化物電極の作製 (京都市産技研)◎紺野祥岐、永山富男、山本貴代、大藏 要、中村俊博	

14:30 ~ 14:45 休憩

座長

	時間		ページ
14	14:45	非晶質酸化物被覆チタン電極を用いる亜鉛電解採取でのアノード電着抑制に対する触媒層組成と電流密度の影響 (同志社大)◎古島広夢、川口健次、盛満正嗣	
15	15:00	濃厚塩化物水溶液を用いる三価クロム電析浴 (京大)◎安達 謙、北田 敦、深見一弘、邑瀬邦明	
16	15:15	ミストCVD法によるMoO ₂ 薄膜成長 (京大)◎股村雄也、池之上卓己、三宅正男、平藤哲司	
17	15:30	次世代リチウムイオン電池への応用に向けた硫化モリブデン薄膜の電析 (大阪技術研)◎池田慎吾、小林靖之、藤原 裕	

15:45 ~ 16:00 休憩

16:00~ 18:00	ポスターセッション(別記プログラム③参照) 16:00~16:20 PRタイム 16:20~17:10 コアタイム(奇数番号のポスター) 17:10~18:00 コアタイム(偶数番号のポスター)	
-----------------	--	--

表中の○、◎は講演者を示す (◎は授賞審査対象者)
表中の講演番号の「企」は企業発表、「技」は技術講演を、それ以外は学術講演を示す。

第20回関西表面技術フォーラムプログラム ②

2018年11月22日

座長

	時間		ページ
18	9:30	熱アシストプラズマ処理における空気混入がフッ素樹脂の表面改質に及ぼす影響 (大院工)◎大久保雄司、中川哲哉、遠藤勝義、山村和也	
19	9:45	亜硝酸系ガスを用いた低合金鋼の新規防錆処理 (大阪技術研)◎佐谷真那実、左藤眞市	
20 企	10:00	Monitoring of SPS concentration during electrodeposition process by rotating ring-disk electrode-2 (微小めっき研究所*、京大エネルギー科学**)◎Tran Van Nhat Anh*、近藤和夫*、平藤哲司**	
21 企	10:15	Reduction of TSV thermal stress by low TCE electrolyte (微小めっき研究所*、京大エネルギー科学**)◎Dinh Van Quy*、近藤和夫*、平藤哲司**	

10:30 ~ 10:45 休憩

座長

	時間		ページ
22 企・技	10:45	平坦性および膜厚均一性に優れた高速電解銅ポストめっきの検討 (上村工業)◎松田加奈子	
23 企・技	11:00	無電解Co-W-P合金めっき膜の高W濃度化とバリア特性 (上村工業)◎佐々木統馬、神崎 翔、柴田利明、黒坂成吾、小田幸典	
24 企・技	11:15	アルミニウム合金上のニッケルめっきに及ぼす熱処理の影響 (三菱電機)◎谷垣剛司、兼松保行	
25 企・技	11:30	耐医療用洗浄剤向け高機能表面の開発及び評価 (サン工業*、神奈川大工**)◎横井健人*、河合陽賢*、松本 太**	
26 企・技	11:45	高機能銀めっきの開発及び評価 (サン工業*、信大**)◎宮川恵実*、河合陽賢*、新井進**	

12:00 ~ 13:15 休憩

13:15	司会 実行委員長 節原 裕一 依頼講演「真空紫外光化学と材料表面処理」 京都大学 杉村 博之 氏	
-------	--	--

14:15 ~ 14:30 休憩

座長

	時間		ページ
27 企・技	14:30	マグネシウムにおけるプラズマ陽極酸化処理技術 (中金)◎徳安善太郎、大島裕一郎、寺西一明	
28 企・技	14:45	酸性浴Zn-Ni-SiO ₂ 複合めっきによる防錆膜 (奥野製薬*、広島工大**)◎野崎匡文*、長尾敏光*、片山順一*、日野 実**	
29 企・技	15:00	アルミニウムアノード酸化皮膜の高耐食性処理 (奥野製薬)◎辻本貴光、森口 朋、原 健二、田中克幸	
30 企・技	15:15	ポリアミド6樹脂上への密着性を有するめっきプロセス (奥野製薬)◎田村美智子、吉川純二、北 晃治	

15:30 ~ 15:45 休憩

座長

	時間		ページ
31 企・技	15:45	パターン銅めっきにおけるめっき厚ばらつき低減 (太洋工作所)◎匠 輝晃、宮崎 毅、奥村昌之	
32 企・技	16:00	研磨加工面と旋盤加工面における硬質クロムめっきのざらつき発生条件 (エフテックス*、広島市産業振興センター**、大阪技術研***)◎大杉 健*、前田英明*、田中善文*、倉本英哲**、中出卓男***	
33	16:15	無電解めっき法により作製したFe-Ni-B合金薄膜の熱応力挙動 (京都市産技研)◎山本貴代、永山富男、紺野祥岐、大藏 要、中村俊博	
34	16:30	電気化学的に形成した高光電流密度CuO光カソード (豊橋技科大*、大阪技術研**)◎伊崎昌伸*、野崎晃太*、湖山貴之*、Khoo Pei Loon*、品川 勉**	
35	16:45	無電解めっきによって作製したCu-Sn合金マイクロチューブ集合体のLi吸蔵容量 (大阪技術研*、奈良先端大**)◎藤原 裕**、芝崎和馬**、高橋雅也**、池田慎吾*、小林靖之*	

表中の○、◎は講演者を示す (◎は授賞審査対象者)
表中の講演番号の「企」は企業発表、「技」は技術講演を、それ以外は学術講演を示す。

第20回関西表面技術フォーラムプログラム ③

2018年11月21日 16:00～18:00 ポスターセッション

P1	電子線照射還元法による無電解めっき用触媒ナノ粒子の合成 (阪大*、奥野製薬**)◎東宏誠*、清野智史*、北晃治**、永峯伸吾**、中川貴*、山本孝夫*
P2	電気化学剥離による酸化グラフェンの作製およびその光還元 (京大)◎窪田 航、宇都宮徹、一井 崇、杉村博之
P3	アルミ基板上に形成した自己集積化単分子膜の溶液耐性評価 (京大)◎日和佐登、宇都宮徹、一井 崇、杉村博之
P4	銀による酸化バナジウムの形状制御とその応用 (近畿大)◎清田悠介、副島哲朗
P5	水相低温合成法により得られるTiO ₂ ナノ粒子とその光触媒特性 (近畿大)◎北村直生、副島哲朗
P6	真空紫外光照射によるSAM末端官能基の反応 (京大)◎井村洸介、宇都宮徹、一井 崇、杉村博之
P7	合金被覆樹脂粒子を導電性マトリックスとする二次電池用空気極の分極特性に及ぼす粒径分布の影響 (同志社大*、東洋アルミニウム**)◎奥村卓矢*、南 和哉**、南山偉明**、盛満正嗣*
P8	ラミネート型水素/空気二次電池の充放電サイクルに伴う電圧および容量変化の要因と対策 (同志社大)◎福元達也、川口健次、盛満正嗣
P9	濃厚Zn(Tf ₂ N) ₂ 水溶液からの金属亜鉛電析 (京大院工)◎井口翔太、北田 敦、深見一弘、邑瀬邦明
P10	パラジウムへの水素の吸蔵および脱離の電気化学測定による検討 (兵庫県立大*、兵庫県立大院工**)◎横野里紗*、角川 舞**、福室直樹**、八重真治**
P11	シリコン上への金の無電解置換析出におけるpHの影響 (兵庫県立大)◎岸本兼人、有田翔太郎、津田多公也、松本 歩、八重真治
P12	火花放電パルスアノード酸化によるZrTiO ₄ 膜の作製と深さ方向結晶構造解析 (近畿大院)◎中尾 凌、岩崎光伸
P13	ZrO ₂ ゲル膜を用いたパターンニングTiアノード酸化皮膜の表面特性 (近畿大)◎乾泰輔、岩崎光伸
P14	高速・室温超塑性発現に向けたSn-Zn合金の電析プロセス構築 (大阪府大)◎金武泉希、湖東弘樹、上杉徳照、瀧川順庸、東 健司
P15	光ダイレクトリソグラフィーによる樹脂上への透明導電膜の作製 (甲南大FIRST)◎吉川結麻、高嶋洋平、鶴岡孝章、赤松謙祐
P16	多孔性金属錯体内でのPdナノ粒子/導電性ポリマー複合体の合成 (甲南大FIRST)◎鉄指聖子、高嶋洋平、鶴岡孝章、赤松謙祐
P17	金属イオンドープポリマー上での相互貫入型金属有機構造体の合成 (甲南大)◎平尾翔也、濱上留帆、大橋卓史、高嶋洋平、赤松謙祐、鶴岡孝章
P18	多孔性金属錯体の構造変換反応を利用した新規発光材料の開発 (甲南大FIRST)◎堀越篤人、高嶋洋平、鶴岡孝章、赤松謙祐

表中の○、◎は講演者を示す (◎は授賞審査対象者)